

第 234 期

中華民國 107 年 6 月

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊

刊期頻率：每月 1 日出刊

出版機關：經濟部智慧財產局

發行人：洪淑敏

總編輯：高佐良

副總編輯：高秀美

編審委員：

黃文發、林清結、吳佳穎、

林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、

何燦成、高佐良、邱淑玟、

黃振榮、徐銘鋒、程芳斌、

張仁平、王琇慧、王德博、

王義明、吳逸玲、林明賢、

高秀美

執行編輯：李楷元、李佩蓁

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>

地 址：10637 臺北市辛亥路

2 段 185 號 5 樓

徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw

服務電話：(02) 23767170

傳真號碼：(02) 27352656

創刊年月：中華民國 88 年 1 月

GPN：4810300224

ISSN：2311-3987

中文目錄 01

英文目錄 02

稿件徵求 03

廣告 04

編者的話 06

本月專題—國際間設計專利發展趨勢

日本加入海牙協定後之國際設計專利申請案 08

審查實務解析

施佩其、魏鴻麟

解析日、韓與我國圖像設計審查實務 37

——以一設計一申請原則為中心

徐銘鋒

論述

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查 77

——以美國、韓國及日本為例（上）

葉雪美

從 Impression Products, Inc. v. Lexmark 106

Intern., Inc. 案看美國專利權耗盡原則之

最新發展

陳志遠

智慧財產權園地 124

智慧財產權資訊 126

智慧財產局動態 135

智慧財產權統計 147

智慧財產權相關期刊論文索引 148

附錄 149

Issue 234
Jun2018

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Shu-Min Hong
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Ching-Chieh Lin;
Chia-Ying Wu; Kuo-Tang Lin;
Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;
Chan-Cheng Ho; Tso-Liang Kao;
Shu-Wen Chiu; Cheng-Rong Hwang;
Ming-Feng Hsu; Fang-Bin Chern;
Jen-Ping Chang; Hsiu-Hui Wang;
Te-Po Wang; Yi-Ming Wang;
Yi-Lin Wu; Ming-Sheng Lin; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Pei-Zhen Li

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23767170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
Advertisement	04
A Word from the Editor	06
Topic of the Month — New Trend in International Design Patent Development	
A Analysis of the Examination International Design Patent Application for Japan Joined the Hague Agreement	08
<i>Pei-Chi Shih 、 Hong-Lin Way</i>	
A Comparative Analysis of the Examination Guidelines for Graphic Image Design in Japan, South Korea and Taiwan —— Focus on One Application per Design Rules	37
<i>Ming-Feng Hsu</i>	
Papers & Articles	
The Analysis of the Substantive Examination and the Trend of International Design Filing under the Hague System —— A Study of the Substantive Examination in U.S., Korea and Japan	77
<i>Sherry H.M. Yeh</i>	
The Latest Development of Patent Exhaustion Doctrine in the U.S. after Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.	106
<i>Chih-Yuan Chen</i>	
IPR Column	124
IPR News	126
What's New at TIPO	135
IPR Statistics	147
Published Journal Index	148
Appendix	149